



プロファイルⅢ (50 nm)

次世代半導体CMPスラリーろ過用



“プロファイルⅢ” (50 nm) フィルターは、最先端CMPスラリーろ過用として開発されました。ポールのメルトブロー技術を使用し、さらに微細なファイバーを用いたメディアにより、非常に低い圧力損失を維持しながら、50 nmのろ過精度を実現しています。

次世代CMPプロセス用セリアスラリーや低濃度のコロイダルシリカスラリーのろ過に最適です。

特長

- 超微細なファイバーによる連続したテーパー孔構造
- 各層で安定した孔径をもち、正確なるろ過が可能

利点

- 長いろ過寿命と高い集塵能力
- 分散ろ過において、高い分級効果

■材質

構成部品	材 質
フィルターメディア	ポリプロピレン
サポートコア、ケージ、エンドキャップ	ポリプロピレン
O-リング	EPDM

■仕様

形状	コード 25	コード 7
カートリッジ長さ	AB04 : 118 mm AB1 : 276 mm AB2 : 524 mm AB3 : 777 mm AB4 : 1,032 mm	AB04 : 165 mm AB1 : 320 mm AB2 : 569 mm AB3 : 817 mm AB4 : 1,066 mm
カートリッジ外径	70 mm	
ろ過精度	50 nm	
最高使用温度	82 °C	
耐差圧 (温度条件 °C)	0.41 MPa @ 30 °C 0.34 MPa @ 50 °C 0.2 MPa @ 70 °C 0.1 MPa @ 82 °C	

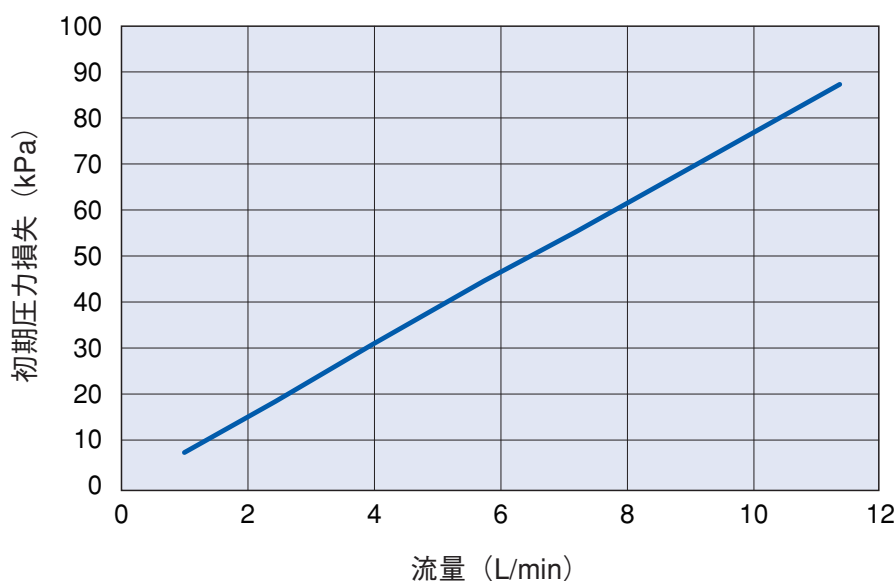
プロフィールⅢ (50 nm)

製品型式：AB ① W0005 ② J

コード	カートリッジ長さ
04	4"
1	10"
2	20"
3	30"
4	40"

コード	O-リング規格	エンドキャップ形状
25	AS568A-222 ダブルO-リング	フラットエンド
7	AS568A-226 ダブルO-リング	ボンフィン

■流量－圧力損失特性(水、20℃)



日本ポール株式会社

マイクロエレクトロニクス事業部

〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1

TEL.03(6901)5700

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。